



复旦大学高分子科学系(所)成立

在原复旦大学高分子教研室基础上发展起来的“高分子科学系”与“高分子科学研究所”已于日前成立。名誉所长于同隐教授,系主任杨玉良教授,所长江明教授,副系主任府寿宽教授、黄骏廉教授。

高分子教研室建于1958年,是上海市最早从事高分子教学与研究的机构,也是全国第一批建立高分子专业的单位之一。

新成立的高分子科学系(所)教学体系完整。除承担本科生教学以外,还是国内首批硕士、博士学位授予点,有配套的学位课和多门选修课。同时,也是国内首批“博士后”流动研究站。

高分子科学系(所)在科研上坚持“基础”与“应用”并重的方针。既承担攀登计划、大基金、重点基金、面上基金、青年基金等等基础研究项目,又承担国家各部委、上海市科委、各企业的众多应用攻关课题。平均每位高级职称的教师承担项目(课题)在两项以上。

(府寿宽)

(上接第133页)

- | | |
|---|--|
| 6 Ito Hiroshi, Peckerar, Martin, Pol Victor, et al. SPIE proceedings, Vol. 1463, 1465, 1466, 1991, Sanjose, USA | 9 Miller R V. Chem. Rev, 1989, 6: 1400 |
| 7 Tabata Y, ed. Polymers for Microelectronics, Proceedings of PME'89, Kodansha Ltd, Tokyo, 1990 | 10 Ito Hiroshi, England W P, Veda Mitsuru. J. of Photopolymer, Sci. & Technol 1990, 3: 219 |
| 8 Willson C G, Bowden M J. ChemTech, 1989, 6: 102 | 11 Hong Xiao Yin Pei Pong Xiang. Proceedings of RadTech Asia'91, Osaka, Japan, 316 |

Progress and Development Trend of Photolithography and Photoresist

Hong Xiaoyin

(Chemistry Department, Tsinghua University, Beijing 100084)

Summary This Paper reviews the recent progress and development trend of photolithography and photoresist for ULSI, including Chemical amplified Resists, Development-free vapor photolithography, Phase shift method and so on.

Key words Photolithography, Photoresist, Photopolymer.

* 本文的编写得到国家自然科学基金委员会胡汉杰同志和中国化学会方智同志的帮助,谨致谢忱。

(上接第177页)

route, i. e., the selective hydrogenation of benzene to cyclohexene, the reaction technology, the preparatixene have also been discussed and analysed concerning with its history, present status and future prospect.

Key words Benzene, Partial hydrogenation, Ru catalyst, Cyclohexene, Polyamide